

Téma č. 11: **Rezistový reliéfní záznamový materiál**

Typ práce:

Zadávající: Ing. M. Květoň, Ph.D.¹⁴

Abstrakt: Principiální použití rezistu, jako reliéfního záznamového materiálu pro optický záznam není novinkou. Nicméně použití dané typu materiálu (např. pozitivní, negativní rezist) a předexpoziční zpracování rezistu (polev dané tloušťky a její adheze k podložce, pečení materiálu), expoziční proces a posléze poexpoziční zpracování tvoří zcela nezanedbatelnou zkušenost pro použití v různých sférách.

V našem případě jsou zejména cílem tlusté (několik μm) tvarové reliéfní difrakční mřížky (při hustotě frekvence mřížky až 1000 period/mm) se snahou vyzískat na základě studia a zkušenosti adepta práce (při maximálním vytěžení zkušenosti týmu) použitelné difraktivní struktury.

Student:

¹⁴<mailto:milan.kveton@jfji.cvut.cz>